

マテリアル先端リサーチインフラ（ARIM） 利用報告書ひな形

ARIM Users' Report template

※の付いている項目は必ず入力してください。

○注意事項の確認

必ずご確認ください。

利用報告書に関する注意事項／Precautions Regarding Users' Report

日本語：https://nanonet.mext.go.jp/data/doc/1733210870_doc_10_0.pdf

English：https://nanonet.mext.go.jp/data/doc/1733798517_doc_10_0.pdf

上記の注意事項を確認しました：☐ はい ☐ いいえ

※課題番号：
※利用形態（主）：
利用形態（副）：
※利用課題名：

利用課題名には、研究目的や利用内容等が理解できる課題名を記載ください。利用課題名は研究テーマ名と同じにする必要はありません。利用の内容を適切に表すようにしてください。

※課題申請者名：
※所属機関名：

課題申請者情報

：
※年齢層：
※所属機関区分：

※公開猶予希望（公開猶予は原則2年まで）：☐ なし ☐ あり（公開猶予期間：)
その他の利用者名：
ARIM担当者名：

※横断技術領域（主）：
横断技術領域（副）：

※重要技術領域（主）：

重要技術領域（副）：

コメントの追加 [ARIM運営室1]: 【全体的注意事項】
本利用報告書は研究論文ではなく、支援機関の利用に関する「利用報告書」です。

重要なお願い
利用報告書は、インターネット上のホームページ等で公開されることを前提に作成ください。例えば、知的財産権確保に必要となる技術（図面等を含む）の記載には十分ご注意ください。特許出願を予定している技術内容は、利用報告書に記載しないことをお勧めします。

コメントの追加 [A2]: いずれか一つを選択下さい。

コメントの追加 [ARIM運営室3]: 申請者のみ記載してください。

コメントの追加 [ARIM運営室4]: 大学は学部学科、大学院研究科まで、企業は企業名のみ、技術研究組合は組合名までの記載してください。

コメントの追加 [A5]: 未取得の方は、取得をお勧めします。
<https://orcid.org>

コメントの追加 [A6]: いずれか一つを選択下さい。
大企業は、資本金3億円以上または、従業員数300人の企業とします。それ以外は、中小企業を選択下さい。

コメントの追加 [A7]: 複数の場合、半角カンマ区切りで、入力をお願いします。

コメントの追加 [A8]: いずれか一つを選択下さい。

コメントの追加 [A9]: 一番近いと思われる領域、いずれか一つを選択下さい。

コメントの追加 [A10]: 上記7つから選択下さい。

利用した設備の ID 番号

キーワード

加工プロセスの場合、以下のようなキーワードを推奨します。「リソグラフィ」、「成膜」、「膜加工・エッチング」、「合成」、「熱処理」、「ドーピング」、「表面処理」、「形状・形態観察」、「分析」、「切削」、「研磨」、「接合」、「電気計測」、「機械計測」、「シミュレーション CAD」。また、可能であれば、応用分野に関するキーワードも歓迎します。

※概要 (Summary)

(技術相談の場合は、概要のみの記載でも構いません。)

積層構造材料の界面状態についての分析を行うため、北海道大学の設備を利用して断面 TEM 観察を行った。また、

※実験 (Experimental)

(実験方法などを記入してください。)

薄膜試料を集束イオンビーム加工装置 (FB-2100) で薄片化し、収差補正電子顕微鏡 (JEM-ARM200F) を用いて透過像を撮影した。また、

※結果と考察 (Results and Discussion)

(報告書の内容を充実して頂くため、全角 100 文字以上、半角 200 文字以上の入力をお願いしています。)

(必要に応じて図表を入れてください。)

Fig.1 に FIB 加工時のイオン像を示す。サンプルに加工ダメージが加わらないよう、電流電圧の調整を行い……

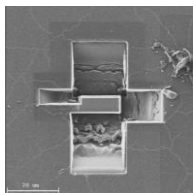


Fig. 1 SIM image of a fabricated thin

その他・特記事項 (Others)

(参考文献、用語説明、謝辞等を、必要に応じて記載下さい。)

- ・参考文献 S. Suzuki et al., APL 97, (2010) 11000.
- ・CREST (JST) 「〇〇の研究開発」
- ・共同研究者：△△株式会社 山田二郎様
- ・鈴木三郎様 (産業ナノ技研 NPF) に感謝します。

論文・プロシーディング (DOI を記入下さい。)

10.1111/joim.12500

(記入任意) H. Sato and I. Tanaka, Jpn. J. Appl. Phys. 111 (2014) 9999.

口頭発表など

コメントの追加 [A11]: 主な装置を、わかる範囲で結構です。入力をお願いします。

また、下記のリンクにおいて検索も可能です。

[共用設備検索 | ARIM Japan 公式ホームページ](#) [マテリアル先端リサーチインフラ \(mext.go.jp\)](#)

コメントの追加 [A12]: 複数の場合、半角カンマ区切りで、入力をお願いします。

コメントの追加 [ARIM運営室13]: 概要

研究開発、技術開発の目的や実施内容等を、開示可能な範囲で、簡潔にご説明ください

コメントの追加 [ARIM運営室14]: 実験

【利用した主な装置】

登録装置一覧に記載されている装置名で記載ください。記載に登録外の装置を加えても構いません。

【実験方法】

(1)支援機関でどのような実験や試作、計測、評価を行ったかを記載ください。支援機関で実施した内容と、別の機関で行った内容 (利用者が自機関へ持ち帰って評価した場合など) が区別できるように記載ください。

(2)加工プロセスの場合はプロセス条件は開示可能な範囲で出来るだけ詳しく記載ください。

コメントの追加 [ARIM運営室15]: 結果と考察

(1)図表は可能な限り掲載ください。図表の番号、説明は必須で、図表の説明(Figure caption)は日本語・英語いずれかで表記ください。利用報告書の読者が、装置を使って何ができるかイメージできるような図表を期待します。

コメントの追加 [ARIM運営室16]: その他・特記事項

(1)利用報告書内で引用した参考文献や、用語の説明がある場合は、ここに記載ください。

(2)共同研究している企業や大学の研究者がいる場合は、名前と所属を開示可能な範囲で記載ください。

コメントの追加 [A17]: 本利用の成果等に関連する利用当該年度以後の論文発表について DOI を記載ください。

まだ、DOI が付けられていない論文等については、DOI が付けられてから追記をお願いします。

DOI がつかない論文は、口頭発表などの欄へ、記入下さい。

コメントの追加 [A18]: 1 件ずつ改行して、入力下さい。

佐藤花子，田中一郎，“新規薄膜材料の断面観察”セラミックス学会 学術講演会，令和 5 年 1 月 1 日．

関連特許

出願 ○件、登録 ○件、または
（記入任意）佐藤花子，“新規薄膜材料”特願 2022-123456，令和 4 年 5 月 10 日．出願番号の記載も可

コメントの追加 [A19]: 当該年度において、利用課題に関連する特許出願、登録がある場合はその件数をお書きください
可能であれば出願番号、登録番号、の記入をお願いします。(任意)